

# 産業構造審議会知的財産政策部会 第 3 回特許制度小委員会

日時 平成 1 4 年 1 1 月 1 5 日（金）午後 3 時 3 0 分開会

会場 特許庁 1 6 階 特別会議室

## < 本日の議論について >

本日は、今後我が国が目指すべき、迅速かつ的確な特許審査の在り方として、補正の見直し、料金体系の見直し、早期審査制度などを含めた総合的な対策を講ずることの必要性について、議論予定。

今後、産業界など関係方面と具体的な議論を深め、次回の委員会では、迅速かつ的確な特許審査の在り方について、できる限り総合的な対策案を委員会としての中間的な報告としてとりまとめる予定。

## < 今後のスケジュール >

今回の議事概要は、月曜日に配布予定。

次回、第 4 回委員会は 1 2 月 1 2 日（木）1 5 時半から（予定）

議題：中間取りまとめ案について